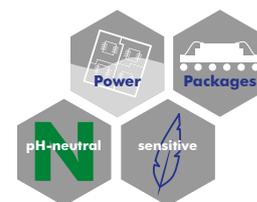


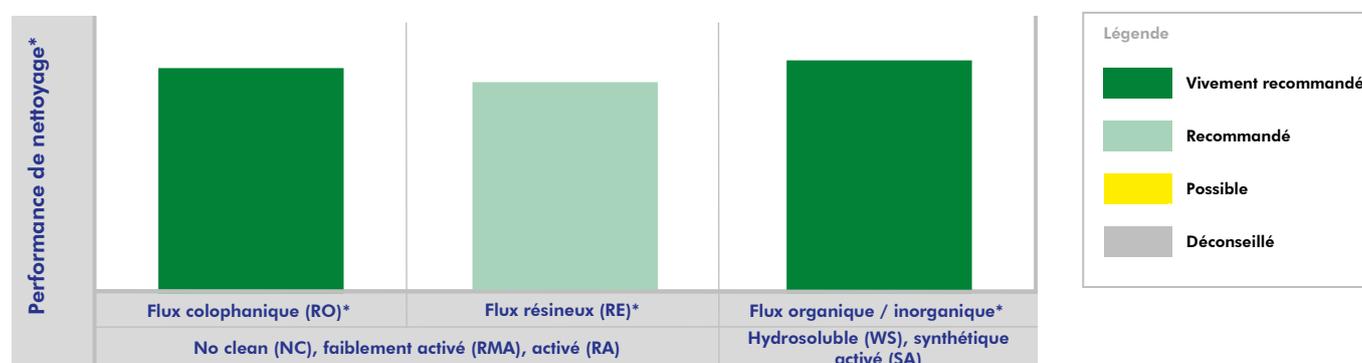
HYDRON® SE 220



Nettoyant à pH neutre destiné à l'élimination du flux dans le domaine des semi-conducteurs

L'HYDRON® SE 220 est un nettoyant à base aqueuse, monophasé, spécialement développé pour les process en immersion. Il élimine parfaitement les résidus de flux des substrats les plus divers, tels que leadframes, composants discrets, modules de puissance et LED de puissance, ou encore les flip chips et CMOS, notamment après fixation de la puce. Du fait de sa formulation monophasée, il offre une très grande facilité de mise en œuvre, de même qu'une excellente rinçabilité, garantissant ainsi des propriétés de surface optimales en vue des process ultérieurs tels le bonding ou l'enrobage. L'HYDRON® SE 220 possède un pH neutre et présente une excellente compatibilité avec les matériaux.

Domaine d'application – Nettoyage de semi-conducteurs



Avantages par rapport à d'autres nettoyants

- Du fait de sa formulation monophasée, l'HYDRON® SE 220 peut être mis en œuvre très facilement et présente une excellente efficacité dans les process de nettoyage en immersion
- Se rince très bien à l'eau DI et ne laisse aucun résidu après rinçage
- Son pH neutre lui confère une excellente compatibilité avec les matériaux, notamment vis-à-vis des puces ; aucune attaque de la passivation.
- Permet d'obtenir des surfaces activées et sans traces, parfaitement adaptées aux opérations ultérieures telles que le bonding, le collage ou l'enrobage ; il confère une protection temporaire aux surfaces activées.
- L'HYDRON® SE 220 est dépourvu de point éclair et peut donc être utilisé dans toute machine de nettoyage en immersion. Faible signature odorante.

Process

Process de nettoyage	Pièce à nettoyer	1. Nettoyage	2. Rinçage	3. Séchage
Ultrasons (US) / Jets immergés (SUI)	modules de puissance, leadframes, composants discrets, LED de puissance, flip chips, CMOS	HYDRON® SE 220	Eau DI ¹	Air chaud ou circulation d'air

¹ Pour le nettoyage d'électronique de puissance, la température de l'eau DI devrait se situer entre 20 et 40°C.

Centres d'essais indépendants – le plus grand choix de machines de nettoyage, nettoyants et systèmes d'analyse



Centre Technique



Centre Analytique

Venez visiter notre Centre de Test de Machines et nettoyez vos modules de puissance dans des équipements mis à disposition par les principaux fabricants internationaux.

Avantages :

- Avec l'aide de votre ingénieur process ZESTRON, vous apprenez à connaître les systèmes de nettoyage et nettoyez vos modules de puissance en conditions réelles.
- Vous vérifiez les résultats de nettoyage immédiatement sur place (ROSE, IR, IC, MEB/EDX, etc.) pour une comparabilité et une transparence maximales des résultats.
- Vous recevez une garantie, ainsi que les paramètres de process détaillés, pour la combinaison machine/nettoyant que nous vous avons recommandée.

Contactez les ingénieurs process de ZESTRON pour des essais de nettoyage : +49 8453 41995 341 ; techsupport@zestron.com

Données techniques*

Densité	(g/cm ³) à 20°C	0,99
Tension superficielle	(mN/m) à 25°C	26,0
Température d'ébullition	°C	> 98°C
Point d'éclair	°C	aucun jusqu'à l'ébullition
pH	10g/l H ₂ O	neutre
Pression de vapeur	(mbar) à 20°C	env. 20
Température d'utilisation	°C	40 - 60°C
Solubilité dans l'eau		miscible
Concentration d'utilisation ¹	Concentré	20 - 25%

* les données techniques ci-dessus correspondent au mélange à 25%.

¹ L'HYDRON® SE 220 doit être dilué à l'eau DI.

Propriétés du produit et directives

	100% conforme aux directives européennes (RoHS 1, 2 & 3, WEEE)	<p>Les cartes électroniques nettoyées dans un process mettant en œuvre le HYDRON® SE 220 répondent aux exigences des standards suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Propreté optique selon IPC-A-610 ▪ J-STD 001 Propreté en termes de résidus ioniques et résineux, ainsi que de débris de corps étrangers. ▪ IPC 5704 : exigences de propreté pour les circuits imprimés nus ▪ IPC-Hdbk-65B : directives pour le nettoyage des cartes électroniques équipées <p>Un procédé de nettoyage utilisant le HYDRON® SE 220 peut aider à réduire la contamination particulaire.</p>
	Testé dans de très nombreuses configurations, il s'avère adapté au nettoyage des crèmes sans plomb	
	La technologie HYDRON® offre des formulations monophasées et une grande facilité de mise en œuvre	
	Le produit ne contient aucune des substances préoccupantes figurant sur les listes SIN & SVHC	

Protection de l'environnement et des conditions de travail

- L'HYDRON® SE 220 est à base aqueuse et biodégradable.
- Il ne contient aucun composé halogéné dans sa formulation. Il est particulièrement respectueux de l'environnement.
- Avant toute utilisation, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du nettoyant.

Disponibilité / Stockage

1 litre	✓
5 litres	✓
25 litres	✓
200 litres	✓

- Disponible en concentré.
- Il est recommandé de stocker l'HYDRON® SE 220, dans son emballage d'origine, à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Ainsi stocké dans un emballage étanche, le produit se conserve au minimum 5 ans.



Informations complémentaires sur le produit

- **Compatibilité des matériaux**
Avant toute utilisation du nettoyant, veuillez consulter la fiche de compatibilité des matériaux.
- **Fiche d'information sur la technologie HYDRON®**
Informations complémentaires sur la technologie HYDRON®
- **Filtres recommandés**
Afin de profiter pleinement de la technologie HYDRON® en ce qui concerne la durée de vie particulièrement longue l'HYDRON® SE 220, la filtration du fluide est recommandée.
- **Fiche de données de sécurité**

Equipements disponibles pour l'optimisation des process

Afin d'assurer la stabilité d'un process de nettoyage, la surveillance et le traitement du bain sont essentiels. Pour l'HYDRON® SE 220, les possibilités suivantes sont à votre disposition :



Mesure de concentration :

- le ZESTRON® EYE, système de mesure automatique et en temps réel de la concentration permettant une traçabilité à 100% ;
- le ZESTRON® Bath Analyzer 20, méthode de mesure manuelle permettant un contrôle simple et rapide de la concentration du nettoyant.